

软 X 线领域层状复制衍射光栅



一、规格说明

标准品

型号	刻线数 N	波长 范围 $\lambda_1 \sim \lambda_2$	检测器 长度 L	设计 mount 参数								外形 尺寸 W×H×T	镀膜 材质
				r	α	r1'	β_1	r2'	β_2	ri'	Bi		
	(条/mm)	(nm)	(mm)	(mm)	(deg.)	(mm)	(deg.)	(mm)	(deg.)	(mm)	(deg.)	(mm)	
30-001	2400	1~6	23.5	237	88.65	235.6	85.81	238.5	80.17	235	90.0	50 × 30 × 10	Au
30-002	1200	5~20	25.3	237	87	236.7	83	241.1	77.1	235	90.0	50 × 30 × 10	Au
30-003	2400	1~7	26.8	236.7	88.6	235.8	85.8	239.5	79.4	235	90.5	50 × 30 × 10	Au
30-004	2400	0.6~4	19.4	236.8	88.65	233.9	86.64	235.8	81.94	233.5	90.0	50 × 30 × 10	Au
30-005	1200	3.5~8.5	11.1	237	87.07	234.8	83.98	236.2	81.3	233.5	90.0	50 × 30 × 10	Ni
30-006	300	20-80	25.3	237.0	87.00	236.7	83.04	241.1	77.07	235.0	90.0	50 × 30 × 10	Au

※ 光栅的刻线是在树脂上完成的。

※ 结露是造成光学特性显著劣化的重要原因，应避免结露。

二、产品详情

软 X 线领域层状复制衍射光栅是一款适用于软 x 射线波段下的校正像差型凹面层状复制衍射光栅。通过离子刻蚀技术及全息曝光的工艺方法，可实际应用于像差校正型的平场多色仪上。